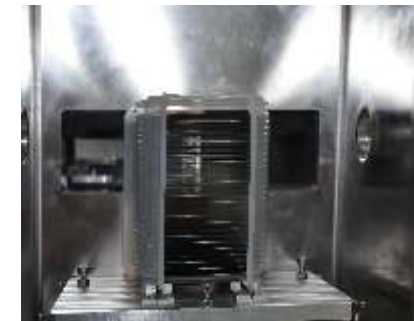


ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА  
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ  
И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАССЕТЫ В КАССЕТУ

## ПЛАЗМА ТМ200-02К

**Назначение:** Глубокое плазмохимическое анизотропное травление кремния в производстве МЭМС, НЭМС, сборок 2,5D и 3D, а так же сквозных высокоаспектных отверстий и др. на базе Bosch-процесса.



### Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле:  $\varnothing$  100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Нагрев стенки реактора до 60°C;
- Гелиевое охлаждение и механический прижим пластин;
- Рабочие газы: Ar, SF<sub>6</sub>, O<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>, He.;
- Скорость анизотропного травления кремния не менее 5 мкм/мин;
- Попеременная подача газа с программируемым временем цикла;
- Мощность потребления не более 19 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

